

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成20年10月2日(2008.10.2)

【公開番号】特開2008-177289(P2008-177289A)

【公開日】平成20年7月31日(2008.7.31)

【年通号数】公開・登録公報2008-030

【出願番号】特願2007-8306(P2007-8306)

【国際特許分類】

H 01 L 21/31 (2006.01)

H 01 L 21/683 (2006.01)

C 23 C 16/46 (2006.01)

H 01 L 21/205 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/31 E

H 01 L 21/68 N

C 23 C 16/46

H 01 L 21/205

【手続補正書】

【提出日】平成20年8月15日(2008.8.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項7】

少なくとも前記膜を形成する際に、膜形成部位に光を照射する光源をさらに有することを特徴とする請求項2から請求項6のいずれか1項に記載の基板処理装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項22

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項22】

少なくとも前記膜を形成する際に、膜形成部位に光を照射し、成膜しつつある膜の電気抵抗を低下させることを特徴とする請求項17から請求項21のいずれか1項に記載の基板処理方法。